

湯浅 新治、片山 利一





技術を社会へ–Integration for Innovation





NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構









磁気トンネル素子(MTJ素子)のトンネル磁気抵抗効果(TMR効果)



MR比 = $(R_{AP} - R_P) / R_P \times 100$ (%) (応用上の性能指数)

TMR効果の機構



TMR効果の研究開発の経緯

低温でTMR効果が発現することが1975年から知られていたが、 室温では実現されなかったため、その後あまり注目されず

GMR効果の発見が契機となり、TMR効果が再び脚光を浴びる





新しい不揮発性メモリ MRAM



Gbit級の大容量 MRAM を実現するには、 ① 150%を超えるMR比 と ② スピン・トルク書き込み の実現が必要





結晶性の酸化マグネシウム MgO(001) に関する理論予測

Fe(001) MgO(001) Fe(001)

<理論予測> 第一原理計算

•Butler et al., Phys. Rev. B 63, 056614-1 (2001).

•Mathon & Umerski, *Phys. Rev.* B **63**, 220403-1 (2001).

MR比>1000%

トンネル障壁の対称性 と トンネル過程

アモルファス Al-O トンネル障壁

対称性なし



電極中の種々のブロッホ状態が 混ざり合ってトンネルしてしまう

MR比が100%を越えられない

結晶 MgO(001) トンネル障壁



支配的にトンネル伝導する

—— MR比>1000%(第一原理計算)

量子力学の教科書に書いてあるトンネル描像



トンネル障壁幅 t を厚くすると、トンネル透過率 T は指数関数的に減少する

 $T \propto \exp(-\sqrt{8m\phi/\hbar^2 \times t})$ m: 電子の有効質量

現実の絶縁体トンネル障壁の電子トンネル



ブロッホ状態 や エヴァネッセント状態は、 (i) 特有の波動関数の軌道対称性 と (ii) 特有のバンド分散 を持っている

ブロッホ状態とエバネッセント状態の界面における接続も重要

MgO障壁内のエヴァネッセント状態の減衰長



ブロッホ状態とエヴァネッセント状態の波動関数の接続

波動関数の対称性が保存されるコヒーレントなトンネルの場合





(例) bcc Fe-Co, ホイスラー合金など



MBE成長によるエピタキシャルMgO-MTJ素子の作製

産総研、JSTさきがけ



XAS: X-ray Absorption Spectroscopy (X線吸収スペクトル) XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism (X線円磁気二色性)

Fe(001) / MgO(001) 界面の研究

放射光を用いた XAS と XMCD の測定(KEK-PF)

Fe - L_{2,3} 吸収端を用いて、界面1原子層のFeを調べる

XAS ⇒ 酸素原子との結合 XMCD ⇒ 磁気モーメント

Miyokawa et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 44 Part II, L9 (2005).

(a) Co(6 ML)/Fe(1 ML)/MgO(001)

界面Feの磁気モーメントとMR比の間には、直接的な相関はない

HDD磁気ヘッドや MRAM の基本構造

MgOトンネル素子の量産技術を開発

HDD産業界で世界標準の 生産用スパッタ装置

大型の Si ウエハ 1日 100枚

現在、スピントロニクス応用の主流技術

界面制御のためのスパッタ成膜プロセスの改良

MgO成膜時に不純ガス分子(主にH₂O)を徹底的に除去

MgO-TMRヘッドの製品化と超高密度 HDD の実現

◆2007年に製品化(HDDメーカー各社)

◆ 500 Gbit/inch²の超高密度HDDが実現 (以前の 3倍以上に)

◆将来的に1 Tbit / inch² まで実現可能

電子顕微鏡写真

垂直磁化 MTJ 素子を用いた スピンRAM の開発

東芝, 産総研, 他, *IEDM* (2008) 12.6.

